

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2008年3月6日 (06.03.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/026451 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/00 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
C08G 18/79 (2006.01) C08G 101/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/065934
- (22) 国際出願日: 2007年8月16日 (16.08.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-230805 2006年8月28日 (28.08.2006) JP
特願2006-234060 2006年8月30日 (30.08.2006) JP
特願2007-184658 2007年7月13日 (13.07.2007) JP
特願2007-184644 2007年7月13日 (13.07.2007) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋ゴム工業株式会社 (TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中井 良之 (NAKAI, Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 木村 毅 (KIMURA, Tsuyoshi) [JP/JP];

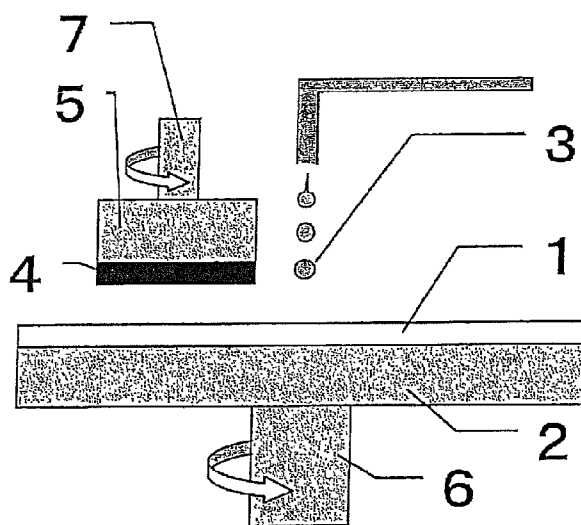
〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 数野 淳 (KAZUNO, Atsushi) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 小川 一幸 (OGAWA, Kazuyuki) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 下村 哲生 (SHIMOMURA, Tetsuo) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP).

- (74) 代理人: 尾崎 雄三, 外(OZAKI, Yuzo et al.); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目13-9 新大阪MTビル1号館 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド



(57) Abstract: Disclosed is a polishing pad which can keep its dimensional stability at a high level during moisture or water absorption. Also disclosed is a method for producing the polishing pad. The polishing pad has a polishing layer comprising a polyurethane foam having fine air-bubble voids. The polyurethane foam comprises a cured material produced by the reaction of an isocyanate-terminated prepolymer comprising an isocyanate monomer, a high-molecular-weight polyol and a low-molecular-weight polyol, a polymerized diisocyanate and a chain extension agent.

(57) 要約: 吸湿又は吸水時に寸法安定性を高く維持することができ、研磨パッド及びその製造方法を提供することを目的とする。本発明の研磨パッドは、微細気泡を有するポリウレタン発泡体からなる研磨層を有しており、前記ポリウレタン発泡体は、イソシアネート単量体、高分子量ポリオール、及び低分子量ポリオールを含有してなるイソシアネート末端プレポリマー、多量化ジイソシアネート、及び鎖延長剤との反応硬化体を含むことを特徴とする。

WO 2008/026451 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK,

TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書